HNUE JOURNAL OF SCIENCE Natural Sciences 2022, Volume 67, Issue 1, pp. 19-26 This paper is available online at http://stdb.hnue.edu.vn

#### NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ LÊN CÂU TRÚC VÀ ỨNG XỬ CƠ TÍNH CỦA VẬT LIỆU GỐM (AIN)<sub>0.9</sub>(Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>)<sub>0.1</sub>

Nguyễn Thị Thảo<br/>1 và Lê Văn Vinh $^2$ 

<sup>1</sup>Khoa Vật lí, Trường đại học Sư Phạm Hà Nội <sup>2</sup>Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Phenikaa, Hà Nội

**Tóm tắt.** Phương pháp động lực học phân tử (ĐLHPT) được sử dụng để mô phỏng ba mẫu vật liệu gốm  $(AIN)_{0.9}(Si_3N_4)_{0.1}$  có mật độ thay đổi từ 2,95 đến 3,88 g.cm<sup>-3</sup>. Sự ảnh hưởng của mật độ lên vi cấu trúc, như sự thay đổi các đơn vị cấu trúc, độ dài liên kết, lân cận chung gần nhất và lỗ hổng, được tiến hành nghiên cứu chi tiết. Các phân tích cho thấy các mẫu vật liệu gồm các vùng vật liệu AIN và vùng vật liệu Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>. Vật liệu AIN gồm phần lớn là các tinh thế AIN với một phần nhỏ vật liệu vô định hình (VĐH) AIN. Vật liệu Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> có cấu trúc vô định hình. Các phân tích về lỗ hổng chỉ ra có sự khuếch tán các nguyên tử Si vào vùng vô định hình AIN và ngược lại có sự khuếch tán các nguyên tử AI vào vùng vô định hình Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>. Các lỗ hổng có bán kính lớn định xứ trong vùng có cấu trúc vô định hình. Số lượng các lỗ hổng có bán kính lớn giảm nhanh chóng khi mật độ tăng lên. Sự giảm các lỗ hổng có bán kính lớn của mẫu vật liệu cải thiện một cách rõ rệt.

Từ khóa: phương pháp động lực học phân tử, AlSiN, tinh thể, vô định hình, cơ tính.

#### 1. Mở đầu

Hệ vật liệu ba nguyên Al-Si-N đã và đang nhận được nhiều sự quan tâm cho các ứng dụng công nghiệp bởi các vật liệu này có đô bền cơ học tuyệt vời, có đô cứng cao, chống lại sự mài mòn và ăn mòn tốt [1-3]. Các màng mỏng Al-Si-N này đã được chế tạo bằng phương pháp phún xa magnetron [1], phún xa magnetron phản ứng [2] và phún xa magnetron xung năng lương cao [3]. Màng mỏng Al-Si-N đã cho thấy các tinh thể AlN có cấu trúc lục giác xếp chặt (hexagonal closed packed – HCP) được hình thành trong các ma trân vật liệu vô định hình (VĐH) Al-Si-N có đô cứng lên đến 24,5 GPa [1]. Trong khi đó các màng mỏng Al-Si-N được chế tao bằng phương pháp phún xa magnetron xung năng lượng cao cho thấy các tinh thể AlN được hình thành có cấu trúc lập phương (cubic) và cả trúc HCP trên nền VĐH Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> [3]. Cơ tính của các màng mỏng này phụ thuộc vào điện thế chêch lệch (bias voltage) bởi vì điện thế chêch lệch làm thay đổi năng lượng bắn phá của các chùm ion làm ảnh hưởng đến mật độ cấu trúc của các màng mỏng. Cũng bằng phương pháp lắng đọng magnetron, Musil và cộng sự [4] đã chỉ ra rằng màng mỏng Al-Si-N có cấu trúc đa tinh thế với tỉ phần của Si dưới 10%, ngược lai nếu tỉ phần của Si lớn hơn 25% màng mỏng Al-Si-N có cấu trúc VĐH. Bằng phương pháp mô phỏng sử dung nguyên lí ban đầu, Sheng và công sư [5] cho thấy rằng sư trôn lẫn ba nguyên Al-Si-N có thể tách thành câu trúc HCP-AlN và pha giả thuyết HCP-SiN. Sự ảnh hưởng của tỉ phân Si lên cấu trúc và cơ tính của vật liêu Al-Si-N cũng đã được nghiên cứu bằng phương pháp đông lực học

Ngày nhận bài: 19/2/2022. Ngày sửa bài: 16/3/2022. Ngày nhận đăng: 23/3/2022. Tác giả liên hệ: Nguyễn Thị Thảo. Địa chỉ e-mail: ntthao.hnue@gmail.com

phân tử (ĐLHPT) [6]. Nghiên cứu này cho thấy pha tinh thể AlN được tạo thành trên nền ma trận VĐH Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>. Tinh thế AlN hầu hết có cấu trúc lập phương tâm mặt (face centered cubic - FCC) và rất ít cấu trúc tinh thể HCP-AlN. Các cấu trúc tinh thể AlN bị nén lại bởi các vật liệu nền ma trận VĐH Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> khi tỉ phần của Si tăng lên. Điều này đã ảnh hưởng đến cấu trúc và cơ tính của hệ vật liệu Al-Si-N. Tuy nhiên ở đây có hai hiện tượng chưa được làm rõ ràng tách riêng ra là sự nén lại của cấu trúc vật liệu Al-Si-N và sự thay đổi tỉ phần của Si. Để làm rõ hiện tượng nén cấu trúc của vật liệu Al-Si-N dẫn tới thay đổi cấu trúc và cơ tính của chúng, chúng tôi tiến hành nghiên cứu hệ vật liệu Al-Si-N với các tỉ phần của cấu nguyên tử Al, Si và N không thay đổi mà chỉ thay đổi mật độ của chúng bằng phương pháp mô phỏng ĐLHPT. Ba mẫu vật liệu Al-Si-N với ba mật độ khác nhau được tạo ra bằng cách làm nguội nhanh từ nhiệt độ 5000 K xuông nhiệt độ 300 K. Cấu trúc, phân bố lỗ hổng (voids) và cơ tính của các mẫu Al-Si-N được tiến hành nghiên cứu chi tiết.

## 2. Nội dung nghiên cứu

#### 2.1. Phương pháp tính toán

Phương pháp ĐLHPT được sử dung để mô phỏng ba mẫu vật liêu gốm (AlN)<sub>0.9</sub>(Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>)<sub>0.1</sub>. Thế tương tác cặp được dùng cho các tượng tác giữa các nguyên tử của các mẫu vật liệu. Cụ thể, tương tác Morse áp dụng cho các cặp tương tác Si-N và Al-N và tương tác cặp Born-Mayer áp dụng cho các cặp tương tác Al-Al, Al-Si, Si-Si và N-N. Các thông số chi tiết cho các thế tương tác được trình bày chi tiết ở công trình [6]. Chúng tôi đã sử dụng chương trình GULP [7] để nhân các thông số thế tương tác cho Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>. Đối với AlN, thông số của thế tương tác nhân được từ đường cong tổng năng lượng của AlN trong công trình [8]. Ngoài ra, với tượng tác Al-Si chúng tôi sử dụng quy tắc Lorentz - Berteloth [9] để nhân thông số thế cho cặp tương tác này. Độ chính xác cũng như sự hợp lí của thể tương tác cho mô phỏng vật liệu Al-Si-N đã được thảo luận và so sánh với các kết quả thực nghiệm cũng như các tính toán khác một cách chi tiết ở nghiên cứu trước [6]. Trong phương pháp ĐLHPT, chúng tôi dùng thuật toán Verlet với bước thời gian mô phỏng là 0,5 fs. Điều kiện biên tuần hoàn được sử dụng trong các mô phỏng này. Ba mẫu vật liệu chứa 10000 nguyên tử (5200 nguyên tử N + 3600 nguyên tử Al + 1200 nguyên tử Si). Các mẫu vật liệu này được mô phỏng với thể tích không thay đổi (điều kiện NVT). Mật độ các mẫu lần lượt là 2,95, 3,20 và 3,88 g.cm<sup>-3</sup> và được kí hiệu là  $S_1$ ,  $S_2$  và  $S_3$  tương ứng. Ban đầu tọa độ các nguyên tử trong mẫu được gieo ngẫu nhiên trong không gian mô phỏng với điều kiện là khoảng giữa hai nguyên tử bất kỳ luôn lớn hơn 1 Å. Chúng tôi nung nóng ba mẫu này tại nhiệt độ 5000 K trong khoảng thời gian 100 ps. Sau đó, các mẫu được làm lạnh xuống nhiệt độ 300 K với hệ số làm lạnh là 10<sup>13</sup> K/s. Tại nhiệt độ 300 K, các mẫu được tiến hành phân tích cấu trúc thông qua hàm phân bố xuyên tâm (PBXT), số phối trí (SPT), phân tích lân cận chung (common neighbor analysis - CNA) [10] và phân tích lổ hổng (voids) [6]. Chúng tôi tiến hành kéo biến dạng một trục trên ba mẫu này tại nhiệt độ 300 K với tốc độ biến dạng 0,04 ps<sup>-1</sup>. Chi tiết về các mô tả biến dạng một trục được mô tả chi tiết ở nghiên cứu [11].

#### 2.2. Kết quả và thảo luận

Hình 1 trình bày HPBXT của ba mẫu  $S_1 \div S_3$  tại nhiệt độ 300 K. Quan sát trên Hình 1a và 1b chúng ta thấy rằng hàm  $G_{Al-N}(r)$  và  $G_{Al-Al}(r)$  của ba mẫu  $S_1 \div S_3$  đều thể hiện cấu trúc tinh thể với các đỉnh phổ thể hiện cấu trúc pha lập phương rocksalt (cấu trúc FCC – NaCl) của AlN. Từ vị trí đỉnh phổ thứ nhất của HPBXT có thể suy ra độ dài liên kết của các nguyên tử. Vị trí đỉnh phổ thứ nhất của hàm  $G_{Al-N}(r)$  giảm từ 1,94 Å xuống 1,90 Å khi mật độ của mẫu tăng từ 2,95 đến 3,88 g.cm<sup>-3</sup>, trong khi đó vị trí đỉnh phổ của hàm  $G_{Al-Al}(r)$  cũng giảm từ 2,79 Å xuống 2,75 Å một cách tương ứng. Điều này cho thấy rằng mạng tinh thể của AlN giảm từ 3,95 Å xuống 3,89 Å khi tăng mật độ từ 2,95 đến 3,88 g.cm<sup>-3</sup>. Các hằng số mạng này, hằng số mạng a0 = 3,95 ÷ 3,89 Å ở 20

các mẫu  $S_1$ ÷  $S_3$ , là khá phù họp với các kết quả, a $0 = 3,982 \div 3,906$  Å, từ tính toán mô phỏng sử dụng các bằng nguyên lí ban đầu [12]. Quan sát trên hình 1c và 1d chúng ta thấy rằng hàm  $G_{Si-N}(r)$  và  $G_{Si-Si}(r)$  thể hiện phổ của vật liệu vô định hình có cấu trúc trật tự gần. Khi mật độ của mẫu tăng lên từ 2,95 đến 3,88 g.cm<sup>-3</sup>, vị trí đỉnh phổ của hàm  $G_{Si-N}(r)$  cũng tăng lên từ 1,67 Å tới 1,73 Å, sự tăng lên này liên quan tới sự chuyển đổi cấu trúc đơn vị từ SiN<sub>3</sub> sang SiN<sub>4</sub> như số liệu đưa ra ở Bảng 1. Ở đây, sự tách đỉnh phổ đầu tiên của hàm  $G_{Si-Si}(r)$  có thể liên quan tới các nguyên tử N liên kết cạnh trong việc liên kết các đơn vị cấu trúc SiN<sub>x</sub> như là của các cấu trúc mạng của vật liệu SiO<sub>2</sub> [13].



Hình 1. Các hàm PBXT của các mẫu tại nhiệt độ 300 K: a) cặp Al-N, b) cặp Al-Al, c) cặp Si-N và d) cặp Si-Si

Bảng 1. Tỉ phần (%) của các đơn vị cấu trúc  $AlN_x$  (x = 4, 5 và 6),  $SiN_y$  (y = 3 và 4) và liên kết  $N(Al,Si)_z$  (z = 2, 3, 4 và 5).

	AlN <sub>4</sub>	AlN <sub>5</sub>	AlN <sub>6</sub>	SiN <sub>3</sub>	$SiN_4$	NAl <sub>4</sub>	NAl <sub>5</sub>	NAl <sub>6</sub>	$NSi_2$	NSi <sub>3</sub>	N(Al,Si) <sub>2</sub>	N(Al,Si) <sub>3</sub>	N(Al,Si) <sub>4</sub>	N(Al,Si)5
<b>S</b> 1	19,39	28,22	52,19	96,75	3,17	3,00	10,15	47,81	29,87	0,42	2,04	3,42	1,73	0,42
S2	12,67	27,94	59,33	74,75	25,25	1,98	9,52	47,69	22,92	5,13	0,92	4,17	4,21	1,77
<b>S</b> 3	2,33	23,42	74,11	5,58	91,25	1,21	9,23	43,83	2,60	15,96	0,02	3,73	10,87	8,02

#### Nguyễn Thị Thảo và Lê Văn Vinh

Hình 2 trình bày các cấu trúc cắt ngang của các mẫu  $S_1 \div S_3$ . Quan sát trên Hình 2 chúng ta có thể nhận thấy rằng các cấu trúc mạng AlN được sắp xếp có trật tự còn ngược lại các cấu trúc Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> ở dạng mất trật tự của cấu trúc VĐH. Rõ ràng rằng, các tinh thể AlN được hình thành trên các nền ma trật vật liệu Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>. Chúng ta biết rằng ở cấu trúc lập phương rocksalt hoàn hảo AlN thì cả hai nguyên tử Al và N đều có số phối trí (SPT) là 6. Tuy nhiên, như số liệu đưa ra ở Bảng 1, các tinh thể AlN trong các mẫu S<sub>1</sub> ÷ S<sub>3</sub> gồm cả các cấu trúc trúc đơn vị AlN<sub>4</sub>, AlN<sub>5</sub> và AlN<sub>6</sub> cùng các liên kết NAl<sub>4</sub>, NAl<sub>5</sub> và NAl<sub>6</sub>. Ở cả ba mẫu, chúng tôi tính toán và nhận thấy rằng các đơn vị cấu trúc AlN<sub>4</sub> và AlN<sub>5</sub> ở bề mặt của tinh thể AlN, trong khi đó ở bên trong của tinh thể AlN chỉ chứa đơn vị cấu trúc AlN6. Điều này cũng tương tự cho các liên kết NAl<sub>4</sub>, NAl<sub>5</sub> và NAl<sub>6</sub>, khi các liên kết NAl<sub>4</sub> và NAl<sub>5</sub> ở bề mặt tinh thể AlN còn bên trong tinh thể AlN chỉ chứa liên kết NAl<sub>4</sub>.



Hình 2. Mặt cắt của các mẫu vật liệu tại nhiệt độ 300 K: a)  $S_1$ , b)  $S_2$  và c)  $S_3$ 

Sử dụng phân tích CNA chúng tôi đã xác định được chính xác tỉ phần các nguyên tử Al thuộc các cấu trúc FCC, HCP và VĐH như chỉ ra trên Bảng 2. Ở mẫu S<sub>1</sub>, tỉ phần các nguyên tử Al thuộc cấu trúc FCC, HCP và VĐH lần lượt là 93,39%, 0,08% và 6,53%. Điều này cho thấy rằng hầu hết mạng cấu trúc AlN là tinh thể có cấu trúc FCC, vài chục nguyên tử của cấu trúc AlN là tinh thể có cấu trúc HCP và một phần nhỏ có cấu trúc VĐH. Khi mật độ mẫu tăng từ 2,95 đến 3,88 g.cm<sup>-3</sup>, tỉ phần các nguyên tử Al thuộc cấu trúc FCC từ từ giảm nhẹ xuống còn 87,67 % ngược lại tỉ phần của các nguyên tử Al thuộc cấu trúc VĐH tăng đến 11,66 %. Trong khi đó tỉ phần các nguyên tử Al thuộc cấu trúc HCP dao động nhưng luôn nhỏ hơn 1%. Điều này cho thấy rằng mật độ đã ảnh hưởng đến sự kết tinh của tinh thể AlN. Khi mật độ tăng lên, các đơn vi cấu trúc bi nén lai dẫn tới các khoảng cách liên kết Al-N và Si-N bi ngắn lai như HPBXT đã chỉ ra ở trên. Sự nén lại này cũng đã gây ra sự chuyển đổi cấu trúc như trình bày trên Bảng 1. Cụ thể, các đơn vị cấu trúc  $AlN_4$  và  $SiN_3$  đã giảm nhanh chóng trong khi các đơn vị cấu trúc AlN<sub>5</sub> giảm nhẹ, ngược lại các đơn vị cấu trúc AlN<sub>6</sub> và SiN<sub>4</sub> đã tăng lên nhanh chóng. Cùng với sự thay đổi tỉ phần các đơn vị cấu trúc, các liên kết NAl<sub>4</sub>, NAl<sub>5</sub>, NAl<sub>6</sub>, NSi<sub>2</sub>, N(Al,Si)<sub>2</sub> đều giảm khi mật độ mẫu tăng lên. Trong khi đó các liên kết NSi<sub>3</sub>, N(Al,Si)<sub>4</sub> và N(Al,Si)<sub>5</sub> tăng lên cùng với sự tăng của mật độ mẫu. Sự thay đổi này có thể làm thay đổi độ xốp của các vùng vật liệu bởi sự thay đổi đơn bị cấu trúc và độ dài liên kết Al-N và Si-N.

	FCC	НСР	VĐH
<b>S1</b>	93,39	0,08	6,53
<b>S2</b>	91,89	0,75	7,36
<b>S</b> 3	87,67	0,67	11,66

Bảng 2. Tỉ phần (%) các nguyên tử Al có cấu trúc FCC, HCP và VĐH.

#### Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ lên cấu trúc và ứng xử cơ tính của vật liệu gốm ...

Để làm rõ tính xốp của các mẫu chúng tôi đã phân tích các lỗ hổng trong các mẫu. Vì các liên kết Al-N và Si-N là các liên kết cộng hóa trị, do vậy trong quá trình tính toán bán kính các lỗ hổng chúng tôi đã chọn bán kính của nguyên tử Al, Si và N là các bán kính liên kết cộng hóa trị. Giá trị bán kính của Al, Si và N lần lượt là ~1,23 Å, ~1,1 Å và ~0,7 Å. Các lỗ hổng là các quả cầu trống rỗng không giao cắt với bất cứ quả cầu nguyên tử nào và nó tiếp xúc với 4 nguyên tử lân cận. Lỗ hổng chỉ tiếp xúc với nguyên tử N và Al gọi là lỗ hổng N-Al. Tương tự lỗ hổng chỉ tiếp xúc với nguyên tử N và Si gọi là lỗ hổng N-Si và lỗ hổng tiếp xúc với các nguyên tử N, Al và Si gọi là lỗ hổng N-Al-Si.



Hình 3. Phân bố bán kính các lỗ hổng trong các mẫu vật liệu: a) tổng các lỗ hổng,
b) lỗ hổng N-Al, c) lỗ hổng N-Si và d) lỗ hổng N-Al-Si (N<sub>V</sub> – số lượng lỗ hổng)

Hình 3 đưa ra các phân bố bán kính của các lỗ hổng trong các mẫu. Ở đây, phân bố bán kính tổng các lỗ hổng ở hình 3a và chúng ta thấy phân bố này có ba đỉnh phổ với đỉnh thứ nhất thấp nhỏ, đỉnh thứ hai cao hẹp và đỉnh thứ ba thấp trải rộng. Để làm rõ sự đóng góp vào các phổ ở hình 3a, chúng tôi đã phân tách các phân bố bán kính của từng loại lỗ hổng. Hình 3b đưa ra phân bố bán kính của các lỗ hổng N-Al của ba mẫu vật liệu. Quan sát chúng ta thấy rằng phân bố bán kính của các lỗ hổng N-Al này đóng góp chính vào đỉnh thứ nhất và thứ hai của phân bố bán kính của các lỗ hổng N-Al này đóng góp chính vào đỉnh thứ nhất và thứ hai của phân bố bán kính tổng thể. Đỉnh chính của phân bố này tăng dần độ cao và vị trí đỉnh dịch chuyển sang trái từ vị trí 0,70 Å xuống vị trí 0,66 Å khi mật độ của mẫu tăng lên. Điều này cho thấy rằng sự chuyển đổi đơn vị cấu trúc AlN<sub>4</sub> sang AlN<sub>6</sub> đã làm tăng số lượng các quả cầu lổ hổng N-Al và sự giảm độ dài liên kết Al-N làm các bán kính lỗ hổng N-Al cũng giảm đi. Hình 3c đưa ra phân bố bán kính của các lỗ hổng N-Si. Quan sát trên hình chúng ta nhận thấy rằng phân bố bán kính của lõ hổng N-Si. Quan sát trên hình chúng ta nhận thấy rằng phân bố bán kính của các lỗ hổng N-Si. Quan sát trên hình chúng ta nhận thấy rằng phân bố bán kính tổng thể. Các đỉnh phổ này có bề ngang rộng. Độ cao của đỉnh giảm nhẹ và vị trí đỉnh phổ dịch chuyển từ vị trí 1,29 Å xuống vị trí 0,96 Å khi mật độ mẫu tăng lên. Rõ ràng sự chuyển đổi đơn vị cấu trúc

SiN<sub>3</sub> sang SiN<sub>4</sub> cùng với sự ngắn lại của độ dài liên kết Si-N đã làm tăng số lượng và làm giảm bán kính của các lỗ hổng loại này. Hình 3d đưa ra phân bố bán kính lỗ hổng N-Al-Si. Chúng ta thấy rằng phân bố bán kính này đóng góp vào cả đỉnh chính và đỉnh phụ bên phải của phân bố bán kính tổng thể. Vị trí của đỉnh phân bố bị dịch chuyển từ 0,96 Å xuống 0,66 Å và độ cao đỉnh tăng lên khi mật độ mẫu tăng lên.



Hình 4. Hình chụp mặt cắt hiển thị các lỗ hổng trong các mẫu: a) S1, b) S2 và c) S3

Để quan sát trực quan các phân bố của các lỗ hổng chúng tôi đã hiển thị trực quan hóa mặt cắt của mẫu để dễ dàng quang sát các lỗ hổng như trên Hình 4. Ở đây ngoài các lỗ hổng N-Al, N-Si và N-Al-Si, chúng tôi còn tìm thấy trong các mẫu có vài chục lỗ hổng chỉ tiếp xúc với các nguyên tử N được gọi là lỗ hổng N. Các lỗ hổng loại N này ở mẫu S<sub>3</sub> có bán kính nhỏ nhất là 0,94 Å và bán kính lớn nhất là 1,7 Å. Trong khi đó ở mẫu S<sub>1</sub> bán kính lỗ hổng N nhỏ nhất là 1,0 Å và lớn nhất là 2,12 Å. Các lỗ hổng N này chỉ định xứ ở vùng vật liệu Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> và vùng biên giữa vật liệu AlN và Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>. Như quan sát trên hình, chúng ta thấy rằng hầu hết các lỗ hổng N-Al sắp xếp theo trật tự và lập thành các vùng rõ rệt. Các lỗ hổng N-Si lớn hơn sắp xếp mất trật tự ở những vùng xác định. Các lỗ hổng N-Al-Si phân bố ở những vùng tiếp giáp AlN và Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>. Ở đây chúng ta thấy rằng có vài lỗ hống N-Al khuếch tán vào vùng lỗ hổng N-Si khuếch tán vào vùng AlN. Điều này chứng tỏ rằng có những nguyên tử Al khuếch tán vào vùng lỗ hổng N-Si trở thành các dải hẹp hơn. Điều này tương ứng với quan sát ở Hình 2 là vùng vật liệu Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> trở thành các dải hẹp hơn khi mật độ mẫu tăng lên.



Hình 5. Đường cong ứng suất - biến dạng của các mẫu  $S_1 \div S_3$ 

Ba mẫu vật liệu  $S_1 \div S_3$  được tiến hành kéo dãn theo trục z. Đường cong ứng suất-biến dạng của ba mẫu này được trình bày trên Hình 5. Ở cả ba mẫu này ứng suất  $\sigma_{zz}$  tăng tuyến tính với biến dạng ε trong khoảng từ 0 đến 6% và khoảng biến dạng này ứng với biến dạng đàn hồi. Úng suất  $\sigma_{zz}$  tiếp tục tăng đến giá trị cao nhất rồi biến đổi lên xuống là là theo phương ngang với độ tăng của biến dạng. Khoảng biến dạng này ứng với biến dạng dẻo. Ở biến dạng đàn hồi, chúng tôi xác định mô đun đàn hồi E của mẫu theo phương biến dạng z. Mô đun đàn hồi E của các mẫu S<sub>1</sub>, S<sub>2</sub> và S<sub>3</sub> lần lượt là  $136 \pm 2$  GPa,  $135 \pm 2$  GPa và  $286 \pm 2$  GPa. Thực nghiệm đo mô đun đàn hồi của các màng mỏng E cho thấy giá trị của E này thay đổi trong khoảng từ  $110 \pm 2$ GPa đến  $143 \pm 2$  GPa phu thuộc vào thế chênh lệch làm thay đổi mật đô và vi cấu trúc của vật liệu Al-Si-N [3]. Ở các mẫu mô phỏng  $S_1$ ÷ $S_3$ , tỉ phần nguyên tử của Si là 12 % và ứng với tỉ phần này thực nghiệm đo được mô đun đàn hồi E của vật liệu Al-Si-N là 290 ± 3 GPa [14]. Điều này cho thấy rằng kết quả mô phỏng này là phù hợp. Dù mật độ của mẫu  $S_2$  tăng làm các đơn vi cấu trúc trong mẫu thay đổi đáng kể nhưng tỉ phần tinh thể của mẫu S1 lại cao hơn, và điều này gây bù trừ dẫn đến mô đun đàn hồi tương đương nhau. Mẫu S<sub>3</sub> tăng mật độ làm vi cấu trúc thay đổi mạnh mẽ và các lỗ trống lớn giảm mạnh so với hai mẫu  $S_1$  và  $S_2$ . Điều này làm cơ tính của S3 được cải thiện rõ rệt.

# 3. Kết luận

Ba mẫu vật liệu  $(AlN)_{0,9}(Si_3N_4)_{0,1}$  với các mật độ 2,95; 3,20 và 3,88 g.cm<sup>-3</sup> (S<sub>1</sub>, S<sub>2</sub> và S<sub>3</sub> tương ứng) được mô phỏng nguội nhanh bằng phương pháp ĐLHPT. Các vật liệu AlN tạo thành các vùng tinh thể mạng lưới các đơn vị cấu trúc AlN<sub>x</sub> (x=4, 5 và 6). Vùng vật liệu AlN này gồm phần lớn là tinh thể FCC AlN, cụm tinh thể HCP AlN vài chục nguyên tử và một phần đáng kể cấu trúc VĐH AlN. Các vật liệu Si3N4 cũng tạo thành các vùng vật liệu VĐH với mạng lưới các cấu trúc đơn vị SiN<sub>3</sub> và SiN<sub>4</sub>. Mật độ của mẫu tăng lên gây ra sự chuyển đổi cấu trúc từ SPT thấp chuyển sang SPT cao hơn và độ dài liên kết Al-N và Si-N bị giảm xuống. Tỉ phần các nguyên tử tinh thể cũng bị giảm đáng kể với sự tăng lên của mật độ. Sự tăng của mật độ cũng làm tăng số lượng các lỗ hổng trong mẫu nhưng lại làm số lượng các lỗ hổng có bán kính lớn giảm đi nhanh chóng ở vùng vật liệu VĐH. Phân tích các lỗ hổng cho thấy có số lượng nhỏ các nguyên tử Al khuếch tán sang vùng vậ liệu VĐH Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> và ngược lại có các nguyên tử Si khuếch tán sang vùng vật liệu VĐH Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> và ngược lại có các nguyên tử Si khuếch tán sang vùng vật liệu VĐH diễn ra mạnh mẽ gây ra sự giảm mạnh các lỗ hổng có bán kính lớn trong mẫu.

*Lời cảm ơn.* Nghiên cứu này được tài trợ bởi Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) trong đề tài mã số 103.05-2019.364.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Soni, M.J. Shekh, S.K. Sharma, S.K. Mishra, 2020. Mater. Character. 169, 110589.
- [2] G. Remnev, V. Tarbokov, S. Pavlov, F. Konusov, S. Zenkin, J. Musil, 2018. Vacuum 158, pp. 65-67.
- [3] J.C. Ding, Q.M. Wang, Z.R. Liu, S. Jeong, T.F. Zhang, K.H. Kim, 2019. J. Alloys Compd. 772, pp. 112-121.
- [4] J. Musil, M. Sasek, P. Zeman, R. Cerstvy, D. Heřman, J.G. Han, V. Satava, 2008. Surf. Coat. Technol., 202, 3485.
- [5] S. H. Sheng, R. F. Zhang, S. Veprek, 2013. Acta Mater., 61, 4226.

Nguyễn Thị Thảo và Lê Văn Vinh

- [6] T.T. Nguyen, T.T. Nguyen, G.T Nguyen, V.V. Le, 2016. Vacuum, 129, pp. 1-8.
- [7] J.D. Gale, 1997. J. Chem. Soc. Faraday Trans., 93, 629.
- [8] S. Zhang, N. Chen, 2005. Chem. Phys., 309.
- [9] G. Ziegenhain, A. Hartmaier, H.M. Urbassek, 2009. J. Mech. Phys. Solids, 57, 1514.
- [10] H. Tsuzuki, P. S. Branicio, J. P. Rino, 2007. Comput. Phys. Comm., 177, 518.
- [11] J. Schiotz, T. Vegge, F. D. DiTolla, K.W. Jacobsen, 1999. Phys. Rev. B, 60, 11971.
- [12] Y.C. Cheng, X.L. Wu, J. Zhu, L.L. Xu, S.H. Li, P.K. Chu, 2008. J. Appl. Phys. 103, 073707.
- [13] V. V. Le, G.T. Nguyen, 2019. J. Non-Crystal. Solids, 505, pp. 225-233.
- [14] A. Pelisson, M. Parlinska-Wojtan, H.J. Hug, J. Patscheider, 2007. Surf. Coat. Technol., 202, 884.

#### ABSTRACT

# $\label{eq:constructures} \begin{array}{c} \text{Density effects on microstructures and mechanical behavior} \\ \text{of } (AIN)_{0.9}(Si_3N_4)_{0.1} \ ceramic \end{array}$

Nguyen Thi Thao<sup>1</sup> and Le Van Vinh<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Faculty of Physics, Hanoi National University of Education <sup>2</sup>Faculty of Information Technology, Phenikaa University, Hanoi

Molecular dynamics (MD) simulations have been used to study three samples of  $(AlN)_{0.9}(Si_3N_4)_{0.1}$  ceramic materials with density varying from 2.95 to 3.88 g.cm<sup>-3</sup>. The influence of density on microstructure, such as the change of structural units, bond lengths, the nearest common neighbors, and voids, was studied in detail. The analysis shows that these samples consist of regions of AlN and Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> materials. The region of AlN material consists mostly of AlN crystals and small amount of AlN amorphous. The region of Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> material has amorphous structure. Void analysis shows that there is the diffusion of Si atoms into the AlN amorphous region and conversely there is the diffusion of Al atoms into the Si3N4 amorphous region. The voids with large radius are localized in the amorphous structure region. The number of these voids decreases rapidly with the increase of density. This reduction improves significantly mechanical properties of samples.

Keywords: MD, AlSiN, crystal, amorphous, mechanical properties.